P4

NHK-SCT-21 US

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-72237

(43)公開日 平成10年(1998) 3月17日

(51) Int.Cl. ⁶		識別配号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
C03C	3/091			C 0 3 C	3/091		
G 0 2 F	1/1333	`5 0 0		G 0 2 F	1/1333	500	

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 8 頁)

	1		
(21)出願番号	特願平9-145495	(71)出願人	000000044
	•		旭硝子株式会社
(22)出願日	平成9年(1997)6月3日		東京都千代田区丸の内2丁目1番2号
•		(72)発明者	西沢 学
(31)優先権主張番号	特願平8-140305		神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地
(32)優先日	平8 (1996) 6月3日		旭硝子株式会社中央研究所内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者	中尾 秦昌
•			神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地
			旭硝子株式会社中央研究所内
·		(74)代理人	弁理士 泉名 謙治 (外1名)
		l .	

(54) 【発明の名称】 無アルカリガラスおよび液晶ディスプレイパネル

(57)【要約】

【課題】歪点≥640℃、熱膨張係数40×10⁻⁷/℃ 未満、密度2.60未満で、バッファードフッ酸による 白濁なく、耐酸性も優れる無アルカリガラスを得る。 【解決手段】重量%表示で実質的に、SiO2:58. 4~66.0%、Al2O3:15.3~22.0%、 B2O3:5.0~12.0%、MgO:0~6.5 %、CaO:0~7.0%、SrO:4.0~12.5 %、BaO:0~2.0%未満、MgO+CaO+SrO+BaO:9.0~18.0%からなる。

(10 Pat Jons

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】歪点が640℃以上であって、重量%表示で実質的に、SiO2:58.4~66.0%、Al2O3:15.3~22.0%、B2O3:5.0~12.0%、MgO:0~6.5%、CaO:0~7.0%、SrO:4.0~12.5%、BaO:0~2.0%未満、MgO+CaO+SrO+BaO:9.0~18.0%からなる無アルカリガラス。

【請求項2】PbO、As2 O3 およびSb2 O3 を実質的に含有しない請求項1記載の無アルカリガラス。 【請求項3】密度が2.60g/cc未満である請求項1または2記載の無アルカリガラス。

【請求項4】熱膨張係数が40×10⁻⁷/℃未満である 請求項1、2または3記載の無アルカリガラス。

【請求項5】リンの含有量が原子重量表示で20ppm 以下である請求項1、2、3または4記載の無アルカリ ガラス。

【請求項6】セルを形成する1対の基板のうちの少なくとも一方の基板として請求項1、2、3、4または5記載の無アルカリガラスを用いた液晶ディスプレイパネル、

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、各種ディスプレイやフォトマスク用基板ガラスとして好適な、アルカリ金属酸化物を実質上含有せずフロート成形可能な、無アルカリガラスおよびそれを用いた液晶ディスプレイパネルに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、各種ディスプレイ用基板ガラス、 特に表面に金属または酸化物薄膜等を形成させるもので は、以下の特性が要求される。

【0003】(1)アルカリ金属酸化物を含有すると、アルカリ金属イオンが薄膜中に拡散して、膜特性を劣化させるため、実質的にアルカリ金属イオンを含まないこと

- (2)薄膜形成工程で高温にさらされるので、ガラスの 変形およびガラスの構造安定化に伴う収縮を最小限に抑 えるため、高い歪点を有すること。
- (3) 半導体形成に用いられる各種薬品に対して充分な 40 化学耐久性を有すること。特にSiOx やSiNx のエッチングのためのフッ酸、フッ化アンモニウム等を主成分とするバッファードフッ酸(BHF)に対して耐久性があること。
- (4) 内部および表面に欠点(泡、脈理、インクルージョン、ピット、キズ、等)をもたないこと。

【0004】従来、各種ディスプレイやフォトマスク用 基板ガラスとしてコーニングコード7059ガラスが広 く用いられている。しかし、このガラスにはデイスプレ イ用として以下に示す不充分な点があった。

2

【0005】(1) 歪点が593℃と低いので、ディスプレイ作製工程におけるガラスの収縮を低減するための前熱処理を、工程前に行わなければならない。

(2)金属電極や透明導電膜(ITOなど)のエッチングに用いる塩酸等への溶出量が多く、ディスプレイ作製工程中で溶出物が再結晶するなどして、ディスプレイ作製に困難がある。

【0006】上記要求に加えて、近年、ディスプレイが 大型化するに伴い次の2点が新たに要求されてきた。

- 10 (1)上記コード7059ガラスの密度は2.76g/ ccであり、さらに軽量化を図るため密度の小さいもの が必要である。
 - (2)上記コード7059ガラスの熱膨張係数が46× 10⁻⁷/℃であり、ディスプレイ作製時の昇降温速度を 上げ、生産効率を上げるため、さらに熱膨張係数の小さ いものが必要である。

【0007】 B_2 O_3 に関しては、特開平1-1608 $44には<math>B_2$ O_3 を $20\sim23$ $カチオン%含有するものが開示されているが、<math>B_2$ O_3 量が多く歪点が充分には高くない。特開昭61-281041 には B_2 O_3 を $0.1\sim4$ 重量%、特開平4-175242 には B_2 O_3 を $0.1\sim5$ モル%、特開平4-325435 には B_2 O_3 を $0\sim3$ 重量%、含有するものが開示されているが、 B_2 O_3 量が少なくBHF に対する耐久性が充分ではない。

【0008】BaOに関しては、特開平4-32543 4にはBaOを10~20重量%、特開昭63-749 35にはBaOを10~22重量%、特開昭59-16 9953にはBaOを15~40重量%、含有するもの が開示されているが、BaOが多く熱膨張係数が大きい うえ、密度も大きい。

【0009】MgOに関しては、特開昭61-132536にはMgOを $6.5\sim12$ 重量%、特開昭59-116147にはMgOを $5\sim15$ 重量%、特開昭60-71540にはMgOを $5\sim17$ 重量%、特開昭60-42246にはMgOを $10\sim25$ モル%、含有するものが開示されているが、MgOを多く含有したガラスは分相がおきやすくなる。

【0010】CaOに関しては、特開昭63-176332にはCaOを11~25重量%、特開昭58-32038にはCaOを7~20モル%、特開平2-13334にはCaOを8~15重量%、特開平3-174336にはCaOを7~12重量%、特開平6-40739にはCaOを10~12重量%、特開平5-201744にはCaOを18カチオン%以上、含有するものが開示されているが、CaOを多量に含有すると熱膨張係数が大きくなる傾向がある。

【0011】Al2 O3 に関しては、特開昭61-23 6631にはAl2 O3 を22.5~35重量%、含有 50 するものが開示されているが、Al2 O3 量が多く塩酸 等への薬品への溶出が多い。

【0012】P2 O5 に関しては、特開昭61-261 232、特開昭63-11543、にはP₂O5 を含有 するものが開示されているが、薄膜の半導体特性を悪化 させ好ましくない。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】また、歪点が640℃ 以上で、熱膨張係数が比較的小さいガラスは、特開平4 -160030、特開平6-263473に記載されて いるので、低密度と低熱膨張係数の両立が難しく、より 大型化をめざすという時代の要請に完全にこたえたもの になっていない。

【0014】本発明の目的は、上記欠点を解決するとと もに、歪点が640℃以上で、熱膨張係数、密度が小さ く、BHFにより白濁をおこさず、塩酸等の薬品への耐 久性も優れ、熔解・成形が容易で、フロート成形が可能 な無アルカリガラスを提供することにある。

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明は、歪点が640 20 ℃以上であって、重量%表示で実質的に、SiO2:5 8. 4~66. 0%, Al₂ O₃ : 15. 3~21. 1 %, B₂ O₃ : 5. 0~12. 0%, MgO: 0~6. 5%, CaO: 0~7. 0%, SrO: 4. 0~12. 5%、BaO:0~2.0%未満、MgO+CaO+S rO+BaO:9.0~18.0%からなる無アルカリ ガラスである。

[0016]

【発明の実施の形態】本発明の無アルカリガラスはアル 的に含有しないものである。具体的にはアルカリ金属酸 化物が総量で0.5重量%以下、より好ましくは0.2 重量%以下とされる。

【0017】上記の通り各成分の組成範囲を限定した理 由について述べる。SiO2 はその含有量が少なすぎる と、歪点が充分に上げられないとともに、化学耐久性が 悪化し、熱膨張係数が増大する。好ましくは59.0重 量%以上である。多すぎると、熔解性が低下し、失透温 度が上昇する。好ましくは65.0重量%以下、より好 ましくは62.7重量%以下である。

【0018】Al2 O3 はガラスの分相性を抑制し、熱 膨張係数を下げ、歪点を上げる。その含有量が少なすぎ ると、この効果があらわれない。好ましくは15.3重 量%以上である。多すぎると、ガラスの熔解性が悪くな る。好ましくは21.1重量%以下である。

【0019】B₂ O₃ はBHFによる白濁発生を防止 し、高温での粘性を高くさせずに熱膨張係数と密度の低 下を達成できる。その含有量が少なすぎると、BHF性 が悪化する。好ましくは5.2重量%以上である。多す ましくは10.2重量%以下である。

【0020】MgOはアルカリ土類金属酸化物の中では 熱膨張係数を低くし、かつ歪点が低下しないため、必須 ではないが、含有させることができる。その含有量が多 すぎると、BHFによる白濁やガラスの分相が生じやす くなる。好ましぐは6.0重量%以下、より好ましくは 3.1重量%以下である。

【0021】Ca0は必須ではないが、含有することに よりガラスの熔解性を向上させうる。一方、多すぎる いる。しかし、このガラスはBaOを相当量必須として 10 と、熱膨張係数を大きくし、失透温度を上げてしまう。 好ましくは6.6重量%以下である。

> 【0022】SrOはガラスの分相を抑制し、BHFに よる白濁に対し比較的有用な成分であるため、必須とさ れる。好ましくは4.6重量%以上である。その含有量 が多すぎると、熱膨張係数が増大する。好ましくは1 2. 1重量%以下である。

> 【0023】BaOは、ガラスの分相を抑制し、熔解性 を向上させ、失透温度を抑制する効果を有する成分であ る。しかし、その含有量が多すぎると、密度が大きくな り、熱膨張係数を増大させる傾向が強い。より密度が小 さく熱膨張係数を小さくするという観点では、1.8重 量%以下、特に0.9重量%以下が好ましく、さらに、 不純物として含有される量を超えて(すなわち実質的 に)含有されないことがより好ましい。

【0024】MgO+CaO+SrO+BaOは、その 合量が少なすぎると、熔解を困難にさせる。好ましくは 10.9重量%以上である。多すぎると、密度が大きく なる。好ましくは17.4重量%以下である。

【0025】近年、液晶表示装置としてすでに商品化さ カリ金属酸化物 (例えばNa2 O、K2 Oなど)を実質 30 れているアモルファスシリコンタイプのTFTを使用し たものに対して、ポリシリコンタイプのTFTが提案さ れ、使用されてきている。ポリシリコンタイプのTFT は、(1)トランジスタの易動度を上げうるので、1画 素あたりの制御時間が短くなり、LCDの高精細化が可 能になる、(2)画面周辺に駆動用ICを実装すること が可能になる、などの利点がある反面、作製工程での強 い熱処理 (例えば、500~600℃×数時間) が必要 になる。

> 【0026】このような高温では、ガラス中の不純物が 40 TFTに拡散して、リーク電流が増大し、TFT特性を 悪化させ、高精細のTFT作製を難しくするおそれがあ る。このような不純物でもっとも問題視されるのは、リ ンである。ガラス基板にTFTを形成する際、熱処理に よってリンがTFT中に拡散し、リーク電流を増大さ せ、TFT特性を悪化させるおそれがあるため、本発明 では、リンは原子(カチオン)重量表示で20ppm以 下にされることが好ましい。

【0027】本発明のガラスは上記成分以外にガラスの 熔解性、滑澄性、成形性を改善するため、ZnO、SO ぎると、耐酸性が悪くなるとともに歪点が低くなる。好 50 3 、F、C1を総量で5モル%以下添加できる。また、

(原子重量カカm)と T

PbO、As2 O3 またはSb2 O3 を含むとガラスカレットの処理に工数を多く必要とするので不純物等として不可避的に混入するものを除き含有しないことが好ましい。

【0028】かくして本発明において好ましい態様のガラスの組成は、例えば、重量%表示で実質的に、SiO2:59.0~62.7%、Al2O3:15.3~21.1%、B2O3:5.2~10.2%、MgO:0~6.0%、CaO:0~6.6%、SrO:4.6~12.1%、MgO+CaO+SrO+BaO:10.9~17.4%からなるものである。

【0029】本発明のガラスは、歪点が640 \mathbb{C} 以上である。また、歪点が650 \mathbb{C} 以上であることが好ましい。熱膨張係数については、 40×10^{-7} \mathbb{C} \mathbb{C} 大精であることが好ましく、特に、 30×10^{-7} \mathbb{C} \mathbb{C} 以上 40×10^{-7} \mathbb{C} 大満であることが好ましい。密度については、2.60 \mathbb{C} \mathbb{C} \mathbb{C} 大満であることが好ましく、より好ましくは2.55 \mathbb{C} \mathbb{C} \mathbb{C} 大満である。

【0030】また、本発明のガラスは、フロート法の成 20 形における成形温度(粘度が10⁴ポイズになる温度)が失透温度より低くないので、フロート成形に適したものになっている。

【0031】本発明のガラスは、例えば次のような方法で製造できる。すなわち、通常使用される各成分の原料を目標成分になるように調合し、これを熔解炉に連続的に投入し、1500~1600℃に加熱して熔融する。この熔融ガラスをフロート法により所定の板厚に成形し、徐冷後切断する。こうして得られたガラス板は、液晶ディスプレイのセルを形成する1対の基板のうちの少30なくとも一方の基板として使用される。

[0032]

【実施例】各成分の原料を目標組成になるように調合し、白金坩堝を用いて1500~1600℃の温度で熔解した。熔解にあたっては、白金スターラを用い撹拌しガラスの均質化を行った。次いで熔解ガラスを流し出し、板状に成形後徐冷した。

【0033】表1~表4には、こうして得られたガラス 組成と熱膨張係数、高温粘度、失透温度、歪点、密度、 耐酸性、耐BHF性を示した。表5~表8は、表1~表 40 4の組成をモル%換算したものである。例1~31は実 施例、例32~例34は比較例である。特に、例28~ 32には、リンの含有量(原子重量ppm)と、TFT 特性を示すリーク電流を併記した。

【0034】熱膨張係数は単位:10-7/℃で示し、高温粘度は粘度が10²、10⁴ ポイズとなる温度(単位:℃)で示し、失透温度、歪点は単位:℃で示し、密度は単位:g/ccで示した。歪点(単位:℃)はJIS R3103に従って測定した。

【0035】耐酸性は、90℃の0.1規定のHC1中 に20時間浸漬後の単位面積あたりの重量減少量(単 10 位:mg/cm²)で示す。耐酸性は0.3mg/cm²以下であることが好ましく、0.2mg/cm²以下 であることが特に好ましい。

【0036】耐BHF性は、NH4 F/HF混液(40 重量%NH4 F水溶液と50重量%HF水溶液とを体積比で9:1に混合した液)中に25℃で20分浸漬後の単位面積あたりの重量減少量(単位:mg/cm²)で示す。耐BHF性は0.7mg/cm²以下であることが特に好ましく、0.6mg/cm²以下であることが特に好ましい。

【0·037】リーク電流は、電極長さ10μmのポリシ リコンタイプTFTをガラス基板上に作成し、ゲート電 圧を-5V、ソース電圧を0V、ドレイン電圧を+10 Vとしたときのリーク電流(単位:pA)を測定した。 リーク電流は50pA程度以下であることが好ましい。 【0038】例1~31のガラスは、熱膨張係数は30 ×10⁻⁷~40×10⁻⁷/℃と低い値を示し、歪点は6 40℃以上と高い値を示し、高温での熱処理に充分耐え られる。密度も2.60g/cc未満で従来のコーニン グコード7059ガラスの2.76g/ccよりはるか に小さい。化学的特性に関してもBHFにより白濁を生 じにくく、耐酸性にも優れる。熔解の目安となる102 ポイズに相当する温度も比較的低く熔解が容易であり、 成形性の目安となる104 ポイズに相当する温度が失透 温度以上になっており、フロート成形時に失透が生成す るなどのトラブルがないと考えられる。

【0039】一方、本発明の範囲外の組成である例3 3、例34は熱膨張係数が大きく、密度が比較的大きい。また、例32はリンの含有量が大きく、リーク電流が大きくなっている。

0 [0040]

【表1】

Q

			.,							
例番号	1.	2.	3	. 4	. 5	6	7	8	9	
SiO ₂ 重量%	60.8	60.3	59.0	60.5	59. 5	62.7	59. 7	58.4	58.6	
Al ₂ O ₃	16.7	16. 3	19.4	15.6	16. 3	17.0	18. 2	21.0	16.6	
B ₂ O ₃	8.3	8.1	8.2	8.5	8.1	9.5	9. 3	9.2	9.3	
MgO	1.2	0.0	0.6	3.1	0.0	2.4	2.4	1.2	0.6	ı
Ca0	4.6	3. 3	4.5	6.0	4.9	3.0	2. 9	4.1	5.8	ı
SrO	8.5	12.1	8.3	6.3	9.4	5.5	5. 7	6.1	9.2	I
Ba0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	I
MgO+CaO	14:3	15. 4	13.4	15.4	16.1	10.9	12. 8	11.4	15.6	I
+Sr0+Ba0										
熱膨張係数	35	37	36	39	39	32	33	33	39	
高温粘度										
103 ポイズ	1730	1750	1730	1660	1730	1750	1740	1710	1700	l
104 ポイズ	1340	1350	1340	1260	1340	1320	1310	1320	1290	ĺ
失透温度	1310	1330	1310	1260	1340	1300	1280	1320	1250	i
歪点	660	660	670	640	655	670	670	680	640	
密度	2.48	2.49	2.48	2. 50	2. 53	2.40	2.46	2. 44	2. 52	
耐酸性	0.10	0.07	0.15	0.13	0. 11	0.12	0.15	0.20	0.13	
耐BHF性	0.48	0.47	0.47	0.50	0. 50	0.48	0.51	0. 53	0. 50	

[0041]

* *【表2】

例番号	10	11	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8
SiO ₂ 重量%	60.0	62. 6	60.7	61.4	60.9	59.1	58. 7	61.4	61.5
Al ₂ O _a	18.0	16. 9	18.2	15.3	16.7	19.5	21. 1	18.1	16.6
B ₂ O ₃	10.2	7.4	7.2	7.3	6.2	6.1	6. 2	5. 2	8.3
Mg0	0.0	2.6	1.6	1.5	1.8	1.2	1. 2	1.2	1.2
Ca0	4.1	3. 7	4.3	5.9	5.0	4.9	6.6	5.0	3.8
SrO	7.6	6.8	8.0	8.6	9.3	9.1	6.1	9.2	7.7
BaO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
MgO+CaO	11.7	13.1	13.9	16.0	16. 1	15.2	13. 9	15.4	13.6
+Sr0+Ba0									
熟膨張係数	33	33	35	39	38	37	37	37	35
高温粘度									
102 ポイズ	1740	1730	1710	1700	1720	1750	1750	1770	1740
104 ポイズ	1340	1340	1340	1320	1310	1320	1320	1340	1330
失透温度	1300	1340	1320	1320	1300	1300	1300	1340	1300
歪点 .	640	680	680	665	685	695	700	710	670
密度	2. 44	2.46	2.48	2. 52	2. 53	2.52	2.50	2. 52	2. 47
耐酸性	0. 28	0.07	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.12
耐BHF性	0.47	0. 52	0.53	0. 56	0. 54	0.56	0.57	0.59	0. 44

例番号	1 9	2 0	2 1	2.2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7
SiO ₂ 重量%	61.1	62. 1	60.0	61.3	59.7	62. 9	63. 0	60.5	60.1
Al ₂ 0 ₃	19.8	18. 1	16.5	16.8	20.0	15. 7	17.3	18. 7	17.0
B ₂ O ₃	7. 3	9. 2	6.1	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4
Mg0	2.4	0.6	1.2	3.6	4.2	5.0	5.6	6.2	3.9
Ca0	3. 9	3.0	4.6	1.7	2.5	2.6	1.7	0.9	4.1
SrO ·	4.6	6.1	10.7	9.3	6.2	6.4	4.8	6.3	7.5
Ba0	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MgO+CaO	11.8	10.6	17.4	14.6	13.0	14.0	12. 1	12. 3	15.5
+Sr0+Ba0									
熟膨張係数 高温粘度	32	31	39	35	33	35	32	33	38
10 ポイズ	1720	1780	1720	1690	1640	1670	1660	1630	1650
104 ポイズ	1340	1350	1310	1310	1280	1290	1290	1270	1270
失透温度	1280	1300	1300	1300	1280	1290	1290	1270	1250
	685	675	670	680	690	690	700	700	660
密度	2.45	2.41	2. 56	2.50	2.49	2.47	2.45	2.49	2. 51
耐酸性	0.07	0.14	0.06	0.08	0.04	0.12	0.17	0.11	(0.1
耐BHF性	0.54	0.46	0.55	0.46	0.48	0.42	0.37	0.40	0. 54

[0043]

* *【表4】

例番号 28 29 30 31 32 3	3 3 4
SiO ₂ 重量% 59.5 60.3 61.1 62.0 63.0 57	2 58.0
Al ₂ O ₃ 19.0 19.3 19.5 19.8 20.2 15	9 16.2
B ₂ O ₃ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7	9 8.0
Mg0 1.2 1.2 1.2 1.2 0.0 1	1 1.2
CaO 0.0 1.6 3.3 5.0 9.4 4	0 4.0
Sr0 13.4 10.5 7.6 4.6 0.0 2	9 6.0
Ba0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10	9 6.6
MgO+CaO 14.6 13.3 12.1 10.9 9.4 18.	9 17.8
+SrO+BaO	
リン含有量 0 4 8 12 22	
熟膨張係数 34 34 33 32 33 42 高温粘度	L 40
1 0 ² ポイズ 1740 1740 1740 1750 1750 169	0 1690
1 0 ポイズ 1350 1350 1350 1350 1350 1350 125	
失透温度 1300 1300 1300 1300 1300 129	
歪点 690 690 690 690 690 690	
密度 2.49 2.47 2.45 2.42 2.40 2.6	-
耐酸性 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	·
耐BHF性 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52 0.5	. 1
リーク電流 2 8 15 30 90	

				• • •					, .
1 1								1	2
例番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SiO ₂ モルタ	- 1	69.0	67.0	66.0	68.0	69.0	67. 0	66.0	66.0
Al ₂ 0 ₃	11.0	11.0	13.0	10.0	11.0	11.0	12.0	14.0	11.0
B ₂ O ₃	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	9.0	9.0
Mg0	2.0	0.0	1.0	5.0	0.0	4.0	4.0	2.0	1.0
Ca0	5.5	4.0	5.5	7.0	6.0	3.5	3.5	5.0	7.0
Sr0	5.5	8.0	5.5	4.0	6.2	3.5	3.7	4.0	6.0
Ba0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0
MgO+CaO	13.0	12.0	12.0	16.0	13.0	11.0	12.0	11.0	14.0
0sB+012+									

[0045]

* *【表6】

例番号	10	11	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	18
SiO ₂ モル%	68.0	69.0	68.0	68.0	68.0	67.0	66.0	69.0	69.0
A120a	12.0	11.0	12.0	10.0	11.0	13.0	14.0	12.0	11.0
B ₂ O ₃	10.0	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	5.0	8.0
Mg0	0.0	4.3	2.6	2.5	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Ca0	5.0	4.3	5.2	7.0	6.0	6.0	8.0	6.0	4.6
Sr0	5.0	4.3	5.2	5.5	6.0	6.0	4.0	6.0	5.0
Ba0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
Mg0+Ca0	10.0	13.0	13.0	15.0	15.0	14.0	14. 0	14.0	12.0
+Sr0+Ba0								·	

[0046]

※ ※【表7】

	<u> </u>									
例番	号	19	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7
SiO₂	モル%	68.0	70.0	68.0	68.0	66.0	68.0	68.0	66.0	66.0
Al ₂ O ₃		13.0	12.0	11.0	11.0	13.0	10.0	11.0	12.0	11.0
B ₂ O ₃		7.0	9.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
Mg0		4.0	1.0	2.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	6.4
Ca0		4.6	3.6	5.6	2.0	3.0	3.0	2.0	1.0	4.8
Sr0		3.0	4.0	7.0	6.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.8
Ba0		0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MgO+Ca0	0	12.0	9.0	15.0	14.0	14.0	15.0	14.0	15.0	16.0
+Sr(0+Ba0		:			į				
Ì			1 .	l		Į.		l	1	

[0047]

★ ★【表8】

例番-		28	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4
SiO ₂	モル%	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	67.0	67. 0
Al ₂ O ₃		13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	11.0	11.0
B ₂ O ₃		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0
Mg0		2.0	2. 0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
Ca0		0.0	2. 0	4.0	6.0	11.0	5.0	5.0
Sr0		9.0	7.0	5.0	3.0	0.0	2.0	4.0
Ba0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	3.0
MgO+CaC) ,	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	14.0	14.0
+SrC)+Ba0							
1		i.	1	i			l	1 1

[0048]

【発明の効果】本発明によるガラスは、フロート法による成形が可能である。また、BHFによる白濁が生じにくく、耐酸性に優れ、耐熱性が高く、低い熱膨張係数を*

*有するのでディスプレイ用基板、フォトマスク基板として適する。特に、密度が非常に小さいので、大型のTF Tタイプのディスプレイ基板等に好適である。